(Ni_{0.81}Fe_{0.19})_{1-x}Cr_x作为种子层对 NiFe/FeMn 交换偏置的影响*

滕 $蛟^{1,2}$) 蔡建旺¹) 熊小涛²) 赖武彦¹) 朱逢吾²)

¹(中国科学院物理研究所磁学国家重点实验室,北京 100080)
 ²(北京科技大学材料物理与化学系,北京 100083)
 (2002年4月4日收到 2002年5月10日收到修改稿)

采用一种新的种子层材料($Ni_{0.81} Fe_{0.19}$)_{-*}Cr_{*},通过改变种子层中 Cr 原子的含量,使得在其上生长的 NiFe/ FeMn 双层膜的织构和晶粒尺寸产生极大的差异,系统研究了 NiFe/FeMn 双层膜中 FeMn 晶粒尺寸和织构对交换偏 置的影响.实验结果表明,在 FeMn 的 γ 相(111)织构较好的前提下,交换偏置场的大小与织构的差异没有关系; FeMn 的晶粒尺寸对交换偏置场有很大影响,较小的反铁磁层晶粒对交换偏置场有利,过大的反铁磁层晶粒不利于 交换偏置场.将($Ni_{0.81} Fe_{0.19}$)_{0.5} Cr_{0.5} 与传统的种子层材料 Ta 进行了对比,发现前者具有很多优点,是一种可能替代 Ta 的新型种子层材料.

关键词:交换偏置,晶粒尺寸,织构,种子层 PACC:7550

1.引 言

铁磁(FM)与反铁磁(AF)材料之间的交换偏置 现象是 20 世纪 50 年代前的一个重要发现^[1].这一 现象的具体表现是,当 FM/AF 双层膜升温至奈尔温 度以上再在磁场中冷却,或者 FM/AF 双层膜在磁场 中生长,其磁滞回线中心在所加外磁场方向偏离零 磁场,同时矫顽力也显著增强.磁滞回线中心偏移量 的大小定义为交换偏置场(*H*_{ex}).近十年来,交换偏 置现象被广泛地应用于巨磁电阻(GMR)自旋阀多层 膜中,在信息存储技术中有着重要的应用^[2].深刻理 解 FM/AF 交换偏置的物理机理,并由此提高其性能 是当前凝聚态物理磁学领域的研究热点.到目前为 止,尽管提出过多种不同的理论模型来理解 FM/AF 体系交换偏置的微观机理,但这些模型都只能解释 某一些特定 FM/AF 体系或交换偏置现象的某一 方面.

与铁磁层紧邻的反铁磁层界面磁矩的补偿或者 未补偿是交换偏置的中心议题之一,虽然不同体系

* 国家自然科学基金重大项目(批准号:19890310)资助的课题.

或甚至同一体系但不同实验者有时给出相互矛盾的 结果 但越来越多的细致研究表明 对于理想的磁矩 完全补偿的反铁磁界面,由于反铁磁的 spin-flop 垂 直界面耦合作用仅导致矫顽力的增强^[3];交换偏置 从本质上来自于反铁磁界面的未补偿磁矩[45],不管 这些未补偿磁矩是反铁磁的内禀磁结构引起还是由 于界面的缺陷或粗糙所造成,因此,对于一定的 FM/ AF 体系,界面的粗糙度、界面缺陷、反铁磁材料的取 向织构及其晶体尺寸等是影响交换偏置场大小的重 要因素.Néel 曾经指出 反铁磁界面的净的未补偿总 磁矩随着反铁磁晶粒的减小而增加,反比于反铁磁 的晶粒尺度⁶¹. Takano 等⁷¹确实发现 CoO/NiFe 双层 膜的 H. 随着 CoO 晶粒的增加以反比于 CoO 晶粒尺 度的规律下降.尽管如此 这一实验的不足之处在于 CoO 的晶粒的改变(从 10 增至 40nm) 是通过改变 CoO 反铁磁层的厚度(从 10 到 300nm) 而获取的.事 实上 当反铁磁厚度达到一定的临界厚度后 许多实 验者都发现 Hex随着反铁磁层厚度的增加而减小, 并且有人认为 这是由于随着反铁磁层厚度的改变, 反铁磁的磁畴结构也发生变化所致^[8,9].

最近 Mauri 等^{10]}在对坡莫合金(以下简称 NiFe) 薄膜的各向异性磁电阻(AMR)效应进行研究时发 现,以(Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{-*}Cr_{*}为种子层的 NiFe 薄膜在 Cr 的原子百分比为 40% 附近出现了非常强的(111)织 构和大晶粒现象 使 NiFe 膜在厚度较小的情况下也 具有较大的 AMR 值.这种新的种子层材料有可能被 应用到 FM/AF 双层膜系统,例如:NiFe/FeMn 双层 膜.众所周知,FeMn 合金通常具有 bcc 结构,是非磁 性的 反铁磁的 FeMn 只有在 γ 相 ,即 fcc 结构才出 现 而 γ-FeMn 为亚稳相. 通常将 FeMn 薄膜生长在 具有 fcc 结构且晶格常量相近的 Cu 或 NiFe 薄膜之 上 使之同构生长以诱发 FeMn 的 γ 相 ,因而对于 NiFe/FeMn 双层膜交换作用体系,NiFe 膜层的织构 和晶粒大小将直接影响 γ -FeMn 的织构和晶粒尺度. 通常人们采用 Ta 作为种子层以使 NiFe 和 FeMn 同 时获得较强的(111)织构,从而得到较大的交换偏置 场^[11-13].本文将研究以(Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{-x} Cr_x 为种子 层 通过调整种子层中 Cr 的原子百分比来控制 NiFe 薄膜织构和晶粒尺寸 ,从而使 γ 相的 FeMn 的(111) 织构强弱和晶粒尺寸大小产生差异,以澄清反铁磁 的织构和晶粒大小是如何影响交换偏置场的 同时, 我们将系统地比较以 Ta 和 (Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{1-x} Cr_x 作为 种子层对 NiFe/FeMn 的交换耦合的影响。

2.实验

实验样品采用直流磁控溅射方法制备.磁控溅 射设备共有 4 个靶位,基片通水冷却.使用合金靶 $Ni_{81}Fe_{19}$, $Fe_{50}Mn_{50}$ 制备 NiFe,FeMn薄膜;在 $Ni_{81}Fe_{19}$ 靶 表面对称放置形状规整的 Cr 片,通过调整 Cr 片的 数量来获得 Cr 原子百分比含量从 33.5% 至 59.8% 的($Ni_{0.81}Fe_{0.19}$)_{-*}Cr_{*} 薄膜.溅射系统本底真空优于 4×10⁻⁵Pa,工作介质 Ar 气压为 0.5Pa.各种靶材的 溅射速率分别测定,它们的范围在 0.1nm·s⁻¹左右. 在基片位置沿平行膜面方向施加有约 36 kA/m 的磁 场.整个实验过程中,制备了两类多层膜:

($Ni_{0.81}$ Fe_{0.19})_{1-x} Cr_x (d nm)/NiFe(10nm)/FeMn (15nm)($Ni_{0.81}$ Fe_{0.19})_{1-x} Cr_x(10nm)

Ta(d nm) NiFe(10nm) FeMr(15nm) Ta(10nm), 其中 x = 33.5%, 38%, 42.5%, 45.7%, 50.4%, 55.1%, 59.8%; d = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12.5, 25nm. 用于磁性测试和 x 射线衍射样品均采用盖玻片作为 基片,用于原子力测试样品则生长在表面氧化的硅 片上、氧化层的厚度约为 500nm.

($Ni_{0.81} Fe_{0.19}$)_{-*} Cr_{*} 层 Cr 的原子百分比由相同 条件下制备的约 300nm 厚度的单层膜通过电感耦合 等离子体发射光谱(ICP-AES)分析获得;用振动样品 磁强计(VSM)在室温下测量了样品的磁滞回线,得 到交换偏场(H_{ex})和矫顽力(H_e);样品的织构、结晶 性通过 x 射线衍射进行分析,x 射线的光源采用 Cu $K\alpha$,功率为 150mA × 40kV;用原子力显微镜测量样 品的粗糙度和面内晶粒尺寸,并得到了其三维显微 模拟图像.

3. 结果和讨论

为了研究反铁磁的织构和晶粒等因素对 NiFe/ FeMn 系统交换偏置场影响 制备了如下系列样品:

基片(Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{-x} Cr_x(12.5nm)/NiFe(10nm)/ FeMr(15nm)(Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{-x} Cr_x(10nm),其中 x = 33.5%, 38%, 42.5%, 45.7%, 50.4%, 55.1%, 59.8%为原子百分比.分别测量了这些样品的磁滞 回线,得到它们的交换偏置场.



图 1 交换偏置场 H_{ex}随种子层中 Cr 的原子百分比的变化关系 横虚线为 NiFe/FeMn 直接生长在基片上时其交换偏置场的值

图 1 为 NiFe/FeMn 系统的交换偏置场 H_{ex} 随种 子层中 Cr 的原子百分比的变化曲线.图 1 中下方的 横虚线对应的是没有种子层时,NiFe/FeMn 系统的 交换偏置场.从图 1 可以看到,没有种子层的 NiFe/ FeMn 系统的交换偏置场较小,随着(Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{-x} Cr_x 种子层的介入,当 Cr 的原子百分比为 33.5%时, 该系统的交换偏置场有了很大增强,随着 Cr 含量的 增加,交换偏置场开始明显下降,在 Cr 的原子百分 比为 42.5%时达到最小,这时 H_{ex} 甚至低于没有种 子层时的值;此后随着 Cr 的含量的增加, H_{ex}迅速变大, 在 Cr 的百分含量为 45.7% 时恢复到 33.5% 时的水平;随着 Cr 含量的进一步增大, H_{ex}略有提高,但基本保持平稳.

Mauri 等¹⁰³的实验结果显示当 Cr 的原子百分比 为40% 左右时,以(Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{-x} Cr_x 为种子层的 NiFe 薄膜会出现将强烈(111)织构和大晶粒现象,但 NiFe/FeMn 的交换偏置场此时却出现了大幅度的下 降,两者之间必有联系.我们对没有种子层及种子层 中 Cr 的原子百分比分别为 33.5%,38%,42.5%, 50.4%等5个典型样品作了 x 射线衍射,在相同条 件下从 35°到 55°对其按步进方式进行 2*θ-θ* 扫描,所 得结果示于图 2.



图 2 几个典型样品的 x 射线 20-0 衍射谱

从图 2 中可以看到,没有种子层的样品仅出现 一个宽而弱的峰,从峰的位置来判断,这个峰是 NiFe(111)峰和 FeMn(111)峰的叠加,说明 FeMn 形 成了 γ相,但其(111)织构较差且晶粒不大.其较小 的交换偏置场似乎与较差的(111)织构相关.当 (Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{1-x}Cr_x 种子层介入后,每个样品都出现 了较强的 NiFe(111) 峰和 FeMn(111) 峰.其中 Cr 百分 含量为 42.5% 的样品衍射峰最强 比其他样品的衍 射峰强了几倍,但是其交换偏置场最小;Cr百分含 量为 50.4% 的样品交换偏置场最大,其衍射峰强度 在 4 个以($Ni_{0.81}Fe_{0.19}$)_{-*}Cr_{*}为种子层的样品中却处 于第二 ;交换偏置场较大的两个样品(Cr百分含量 分别为 50.4% ,33.5%)的交换偏置场值相差不大, 衍射峰强度却相差一倍,这些结果说明在 FeMn (111) 织构较好的情况下,交换偏置场的大小与 FeMn 薄膜的织构的差异没有明显关系.另一方面, 根据 FeMn(111)峰的半峰宽,计算出 4 个以(Ni_{0 81} Feon)___Cr_为种子层的样品的反铁磁层的沿生长

方向的相干长度 具体见表 1.

表1 不同样品反铁磁层的相干长度

样品中 Cr 的原子百分比/at%	33.5	38	42.5	50.4
相干长度 1/nm	12	16.5	17	13

可以发现,交换偏置场较大的两个样品相干长 度较小(比 FeMn 层的厚度稍微小一些),而交换偏 置场较小的两个样品其相干长度较大(比 FeMn 层 的厚度稍微大一些).相干长度反映着 FeMn 晶粒大 小,如果样品的界面粗糙度没有因种子层中 Cr 的含 量而变化,交换偏置场的大小则更依赖于反铁磁的 晶粒尺度.为此我们对样品做了原子力测试,得到其 面内晶粒尺寸和粗糙度.

在表面氧化的硅片上生长($Ni_{0.81}$ Fe_{0.19})_{-x} Cr_x (12.5nm)/NiFe(10nm)/FeMn(15nm)三层膜,其表面 可以模拟 NiFe/FeMn 的界面,它的平整情况反应了 界面的粗糙度,原子力显微镜观测的结果表明,所有 样品的表面粗糙度都在 0.2-0.3nm ,表明界面非常 光滑 种子层中 Gr 的原子百分比含量的变化没有引 起界面粗糙度的变化,但是,随着 Cr 的原子百分比 含量的变化 FeMn 的晶粒大小发生了显著变化,对 于交换偏置场较大的样品 "FeMn 晶粒较小 ,交换偏 置场较小的样品,FeMn 晶粒较大,Cr 的原子百分比 为42.5%的样品的交换偏置场最小,FeMn 晶粒最 大 约为 21nm,这个数值与 Mauri 等的结果是一致 的 ;而对于 Cr 的含量为 50.4% 的样品 FeMn 的面内 晶粒最小 仅为 16nm 左右.图 3 为 Cr 的原子百分比 分别为 42.5% 和 50.4% 的两个典型样品的原子力 三维图像,可见两者面内晶粒大小有明显区别.

以上实验结果表明在 NiFe/FeMn 体系中,FeMn 的 γ 相和较好的(111)织构是产生较大交换偏置场 的必要条件,但在此基础上,织构的差异对交换偏置 场的大小并无明显影响;FeMn 的晶粒尺寸才是影响 交换偏置场的重要因素.依据 Néel 的理论预言^[6], 从本质上而言,反铁磁晶粒尺寸的变化,改变了反铁 磁界面未补偿磁矩,从而影响交换偏置场的大小.

(Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{-x}Cr_x作为一种新的种子层,具有 多重可调性,当Cr的原子百分比含量约为50%时, 在(Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{2.5}Cr_{0.5}上生长的NiFe/FeMn双层膜, FeMn 层具有较好的织构和较小的晶粒以及非常平 整的界面,交换偏置场较理想.作为本文的最后一部 分,将它与传统的种子层材料Ta分别作为种子层, 在不同的厚度下在其上生长了NiFe/FeMn双层膜,



2852

(b)Cr的原子百分含量为 42.5%

图 3 种子层中不同 Cr 含量时 NiFe/FeMn 系统的表面原子力显微 镜图

比较了双层膜的钉扎性能.图 4 是以($Ni_{0.81} Fe_{0.19}$),5 Cr_{0.5}和 Ta 作为种子层时 NiFe/FeMn 系统的 H_{ex} 随种 子层厚度的关系.从图 4 可以看到,以($Ni_{0.81} Fe_{0.19}$),5 Cr_{0.5}为种子层和以 Ta 为种子层,交换偏置场随着种 子层厚度的变化趋势是一致的.但是,以($Ni_{0.81}$ Fe_{0.19}),5Cr_{0.5}为种子层的样品,钉扎效果稍好于以 Ta 为种子层的样品,其最大交换偏置场提高7%.需要 特别指出的是,两者所需要的临界厚度($Ni_{0.81}$ Fe_{0.19} $\lambda_{.5}$ Cr_{0.5}比Ta小了近2nm,而在此厚度下,交换 偏置场提高了20%,且($Ni_{0.81}$ Fe_{0.19} $\lambda_{.5}$ Cr_{0.5}本身电阻 率较Ta为大,这时种子层的分流较小,将导致自旋 阀 GMR 值的提高.此外($Ni_{0.81}$ Fe_{0.19} λ_{-x} Cr_x在300°C 时与 NiFe 之间基本无扩散,此温度下Ta 与 NiFe 有 较严重的扩散^[10].可见($Ni_{0.81}$ Fe_{0.19} $\lambda_{.5}$ Cr_{0.5}与Ta 相比 有诸多优点,是一种可能替代Ta 的种子层材料.



图 4 (Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{0.5} Cr_{0.5} 与 Ta 作为种子层时 NiFe/FeMn 双层膜 的交换偏置场的对比

4.结 论

采用一种新的种子层材料(Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{-*} Cr_{*}. 通过改变其中 Cr 的成份实现了对 NiFe/FeMn 双层 膜系统中反铁磁层的晶粒尺寸和织构的调控,对 NiFe/FeMn 体系的交换偏置机理进行了研究.实验 结果表明,1)在 FeMn 的γ相的(111)织构较好的前 提下 织构的差异对交换偏置场的大小没有明显影 响 2)FeMn 的晶粒尺寸对交换偏置场有很大影响. 随着晶粒尺寸的增大,交换偏置场明显下降,过大的 晶粒尺寸不利于 FeMn 对 NiFe 的钉扎;3)作为种子 层材料 (Ni_{0.81} Fe_{0.19})_{0.5} Cr_{0.5}比 Ta 有诸多优点,是一 种可能替代 Ta 的优良的种子层材料.

- [1] Meiklejohn W H and Bean C P 1956 Phys. Rev. 102 1423;
 Meiklejohn W H and Bean C P 1957 Phys. Rev. 105 904
- [2] Fontana R E , McDonald S A , Santini H A and Tsang C 1999 IEEE Trans . Magn . 35 806
- [3] Schulthess T C and Butler W H 1998 Phys. Rev. Lett. 81 4516
- [4] Gökemeijer N J, Penn R L, Veblen D R and Chien C L 2001 Phys. Rev. B 63 174422
- [5] Takano K , Kodama R H , Berkowitz A E , Cao W and Thomas G

1997 Phys. Rev. Lett. 79 1130

- [6] Néel L 1988 Selected Works of Louis Néel ed. by N Kurti (New York :Gordon and Breach) p469
- [7] Takano K , Kodama R H , Berkowitz A E , Cao W and Thomas G 1998 J. Appl. Phys. 83 6888
- [8] Ambrose T and Chien C L 1998 J. Appl. Phys. 83 6822
- [9] Sang H , Du Y W and Chien C L 1999 J. Appl. Phys. 85 4931
- [10] Lee WY, Toney MF and Mauri D 2000 IEEE Trans. Magn. 36

381

- [11] Choe G and Gupta S 1997 Appl. Phys. Lett. 70 1766
- [12] Fujiwara H, Nishioka K, Hou C, Parker M R, Gangopadhyay S and Metzger R 1996 J. Appl. Phys. 79 6286
- [13] Li M H, Yu G H, Jiang H W, Cai J W and Zhu F W 2001 Acta Phys. Sin. 50 2230 (in Chinese)[李明华、于广华、姜宏伟、蔡 建旺、朱逢吾 2001 物理学报 50 2230]

The influence of ($Ni_{0.81}Fe_{0.19}$)_{1-x}Cr_x seed layer on the exchange bias of NiFe/FeMn bilayers *

Teng Jiao¹⁽²⁾ Cai Jian-Wang¹ Xiong Xiao-Tao² Lai Wu-Yan¹ Zhu Feng-Wu²

¹ (State Key Laboratory of Magnetism, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China) ² (Department of Materials Physics and Chemistry, Beijing University of Science and Technology, Beijing 100083, China)

(Received 4 April 2002 ; revised manuscript received 10 May 2002)

Abstract

A thin ($Ni_{0.81} Fe_{0.19}$) $\lambda_{-x} Cr_x$ seed layer was employed to alter the crystallinity and grain size of NiFe/FeMn bilayers through varying Cr content , and the effect of the crystallinity and grain size on the exchange bias of NiFe/FeMn has been investigated. It has been found that , the interface of NiFe/FeMn is quite smooth for the films grown on the seed layer of ($Ni_{0.81} Fe_{0.19}$) $\lambda_{-x} Cr_x$, and the difference of the crystallinity of FeMn layer is not the cause of the variation in the exchange bias field once a well textured FeMn layer is achieved. On the other hand , the exchange bias field depends strongly on the grain size of the FeMn layer , i.e. the exchange bias decreases rapidly with the increase of FeMn grain size , which is consistent with Néel 's theoretical prediction. Finally ($Ni_{0.81} Fe_{0.19}$) $\lambda_{-5} Cr_{0.5}$ has been compared with Ta as the seed layer of NiFe/FeMn films from the aspects of exchange bias , thermal stability and electric resistivity. It has been shown that the former has more merits , and could be a promising seed layer in the future.

Keywords : exchange bias , crystallinity , grain size , seed layer PACC : 7550

^{*} Project supported by the Major Program of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 19890310).